

半導体製造装置

Wet Station

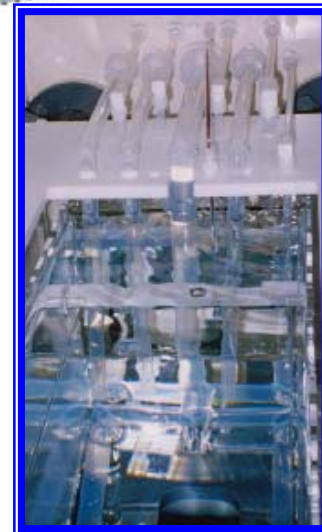
High Quality & Multi-Cleaner

特徴 対象物 … Si ウェハー / 化合物半導体 / 液晶ガラス基板 etc

[多目的]	開発・実験対応型機	[専用カセット使用] 4~12 inch、100~300mm 迄対応可能
[生産]	多品種 / 少量生産対応型機	[枚葉処理] 6~8 inch、100~300mm 迄対応可能 300mm 専用機対応可能(但し、チャック部交換要)

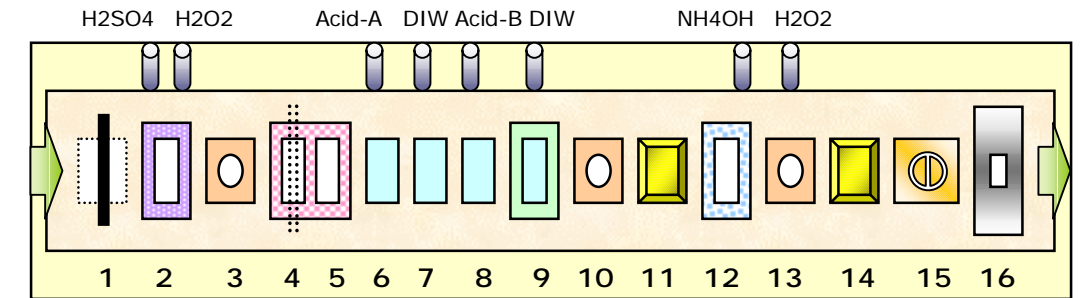


仕上げ工程用洗浄機



■ 機能説明

1 装置構成



レシビパターン

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
モード	ローダ	硫酸 / 過水洗浄	クイックタンプリンス	ブラシスクラブ洗浄	待機リンス	酸A洗浄	酸A洗浄	酸A洗浄	酸B洗浄	クイックタンプリンス	ウルトラソニックリンス	アンモニア / 過水洗浄	クイックタンプリンス	メガソニックリンス	乾燥スピンドライヤー (自動バランサ付)	アンローダ
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																

スクラブ洗浄処理は 5の待機リンス槽に投入されたカセットより1枚づつ基板を取り出し、4のスクラブステーションに搬送し洗浄します。完了後 5の待機カセットに戻します。待機リンス槽カセット内の全ての基板を処理したら次のステーションにカセット搬送します。

No.6,7,8の酸A洗浄は純水との混合比を変えることで濃度差をつけてあります。

2 自動化 (一部オプション対応)

- ローダー・アンローダーと外付けAGVとの取合い自動化
- ローディング・アンローディング カセット カセット / カセット ポートの入替え自動化
- FOUPカセットとの自動化etc

3 CIM 生産情報の管理 (オプション対応)

- 被洗浄物のロット処理管理
 - 温度管理
 - 薬液供給管理
 - 異常警報管理
 - 循環流量管理
 - 薬液濃度管理
- …等のデータを上位パソコンへリアルタイムで情報提供可能です。